

tok 東京応化工業株式会社



*Pioneering
Future
Dimensions*

アニュアルレポート 2005
2005年3月期

tok

戦略

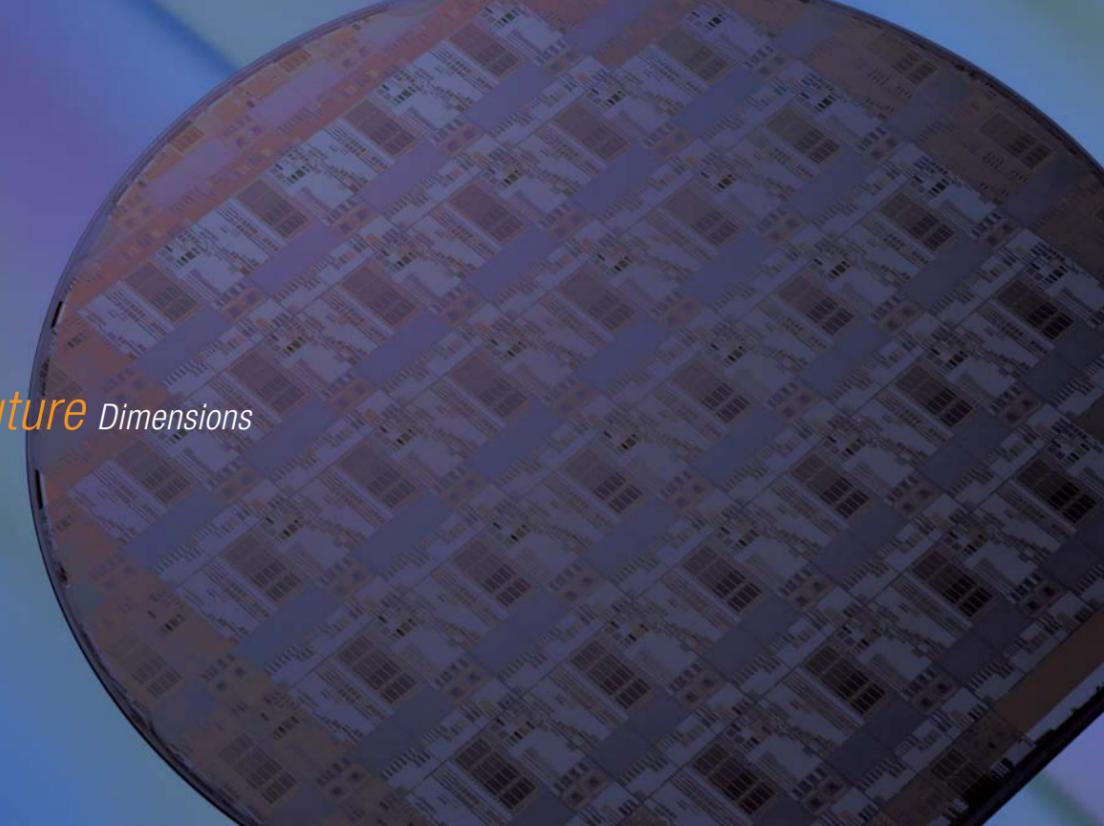
- ➔ 微細加工技術の多角的展開
- ➔ 海外展開の強化
- ➔ 経営基盤の強化

財務

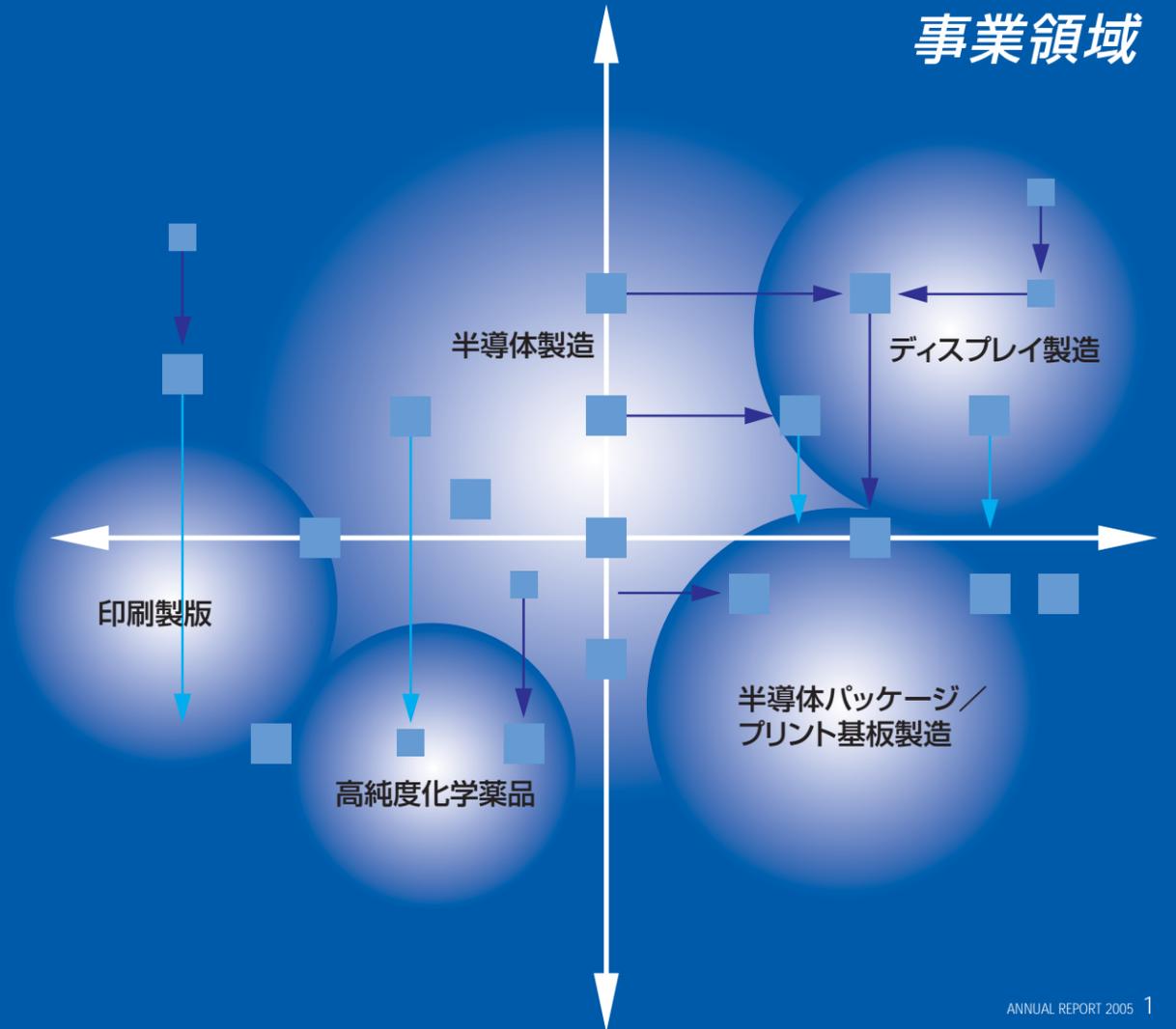
- ➔ 2005年3月期は増収増益を達成しています。
 - 連結売上高は、前期比7.0%増の889億6千万円。
 - 連結営業利益は、前期比27.9%増の72億95百万円。
 - 連結経常利益は、前期比33.4%増の80億51百万円。
 - 連結当期純利益は、前期比7.1%増の50億88百万円。
 - 1株当たり年間配当金は、前期の22円より5円増配し27円。

目次	事業領域/ 事業セグメント	キートンピックス
	1	2
社長メッセージ	コーポレート・ ガバナンス	環境保全活動
4	10	11
会社情報	TOKグローバル ネットワーク	
12	13	

Pioneering *Future* Dimensions

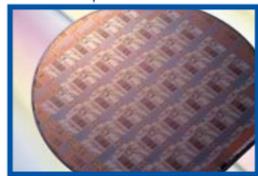


事業領域



東京応化は、1940年の創立以来一貫して「明日のための新技術・新技法の追求」を進めています。水酸化カリウムの電解、高純度の水酸化カリウム・水酸化ナトリウムの精製および塩化物の製造から出発し、現在では、半導体やフラットパネルディスプレイの製造に不可欠なフォトレジスト等を提供しトップサプライヤーとして高い評価をいただき、最先端エレクトロニクス産業の一翼を担っています。

グローバル化の進展によりますます厳しさを増す国際競争の時代にあつて、当社は、主力事業であるファインケミカル分野での優位性の確保、海外市場への積極的展開、およびこれらを推進していくうえでの経営基盤のさらなる強化を図り、21世紀に大きく飛躍する企業を目指していきます。



事業領域／事業セグメント

	材料事業											装置事業			
	フォトレジスト部門			印刷材料部門			化成品部門			特殊化学材料部門			プロセス機器部門		
	2004年3月期	2005年3月期	対前期増減率(%)	2004年3月期	2005年3月期	対前期増減率(%)	2004年3月期	2005年3月期	対前期増減率(%)	2004年3月期	2005年3月期	対前期増減率(%)	2004年3月期	2005年3月期	対前期増減率(%)
売上高(百万円)	32,112	35,005	9.0	6,577	6,820	3.7	23,098	25,013	8.3	4,751	4,572	▲3.8	16,263	17,461	7.4
売上構成比率(%)	38.6	39.3		7.9	7.7		27.8	28.1		5.7	5.1		19.5	19.6	
	主要製品														
半導体製造分野	ArFエキシマレーザー用フォトレジスト KrFエキシマレーザー用フォトレジスト 電子ビーム用フォトレジスト i線用フォトレジスト g線用フォトレジスト ゴム系フォトレジスト						フォトレジスト現像液 剥離液 リンス液 シンナー 希釈液 下層反射防止膜 上層反射防止膜			層間絶縁膜材料 低誘電率層間絶縁膜材料 平坦化絶縁膜材料 半導体高濃度拡散剤 高純度水溶性樹脂溶液			プラズマエッチング装置 プラズマアッシング装置 SODスピナー フォトレジストスピナー 薬液自動希釈供給装置 UVハードニング装置		
半導体パッケージ/プリント基板製造分野	ウェハレベルCSP用フォトレジスト バンブ形成用フォトレジスト COF/Tape CSP/TAB用フォトレジスト FPC用フォトレジスト リードフレーム用フォトレジスト ケミカルミリング用フォトレジスト めっき用フォトレジスト MEMS用フォトレジスト ドライフィルムレジスト						フォトレジスト現像液 剥離液 リンス液 シンナー 希釈液 消泡剤 ストップアウト液						厚膜スピナー 超厚膜ノンスピナー 高速フォトレジスト現像装置 ディスクアッシング装置 プラズマアッシング装置 UVハードニング装置		
ディスプレイ製造分野	TFT-LCD用フォトレジスト STN/TN-LCD用フォトレジスト LCDカラーフィルター用顔料分散型フォトレジスト PDP用フォトレジスト PDPパリアリブ形成用ドライフィルムレジスト 有機ELD用フォトレジスト CRT用フォトレジスト						フォトレジスト現像液 剥離液 リンス液 シンナー 希釈液			LCD用オーバーコート材料 CRT蛍光体接着材料 フォト蛍光体ペースト フォトビークル			TFT/カラーフィルタープロセス用ノンスピナー TFT/カラーフィルタープロセス用ノンスピナー/現像装置 TFT/カラーフィルタープロセス用スピナー TFT/カラーフィルタープロセス用スピナー/現像装置 現像装置 洗浄装置		
印刷製版分野				フレキソ印刷用感光性樹脂版 一般印刷用感光性樹脂版 母型取り用感光性樹脂版 オフセット印刷用PS版 スクリーン印刷用製版感光性材料			樹脂版現像液						感光性樹脂版製版装置		
高純度化学薬品							水酸化カリウム 水酸化ナトリウム 炭酸カリウム 無機不燃性熱媒体 ベンジルアルコール ベンジルアセテート 桂皮酸 SVアセトン SVメタノール								

(注) 2006年3月期より、市場の変化による事業内容の実態を適切に表示するため、材料事業セグメント内における部門別数値の集計方法および印刷材料部門以外の部門名称の見直しを行っております。

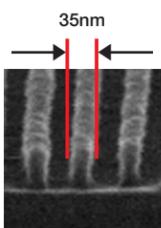
微細加工技術の多角的展開

東京応化は、「高度な微細加工技術を必要とする各分野の先端領域」において「微細加工技術の多角的展開」を推進しています。

この「微細加工技術の多角的展開」は、「微細加工技術の垂直的展開」と「微細加工技術の水平的展開」の両面から構成されます。

微細加工技術の垂直的展開

当社の志向する「微細加工技術の垂直的展開」とは、まさに微細化を追求することであり、微細加工技術のさらなる深化を図ることともいえます。微細化は特に半導体製造分野で目覚ましい進展を遂げており、この分野での微細加工技術がフラッグシップであると考えています。現在、最先端の製造ラインでは100nm(1nmは、1,000,000分の1mm)を下回る微細加工が行われています。



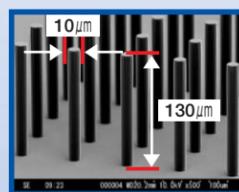
(写真1)
二光束干渉露光装置
による解像結果
(波長193nm)

半導体製造分野では、現在、次世代の露光技術として液浸露光技術が最も注目されています。

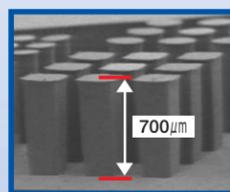
当期この技術と193nmの露光波長を用いた実験の結果、他に先駆け大きな飛躍となる35nmのフォトレジストパターンの解像に成功しました(写真1)。これは、液浸露光という技術を用いることにより、理論上だけではなく現実に微細化が可能だという一つの自信となったことで意義深いものがあります。また、これまでは化学増幅型フォトレジストの限界解像度は50nm程度とみなされていましたが、その限界を大きく乗り越えたことも重要な意味を持ちます。

当社は、早期から液浸露光技術の実用化研究に取り組んでおり、フォトレジストのみを提供するのではなく、この技術の導入時のリスクを低減するカバーコート等の、様々な材料やプロセスからの提案を行っています。

「微細加工技術の垂直的展開」は、半導体製造分野だけのことではなく、また、ただ単に微細化を進めることでもありません。フラットパネルディスプレイ、半導体パッケージ、プリント基板、MEMS等、様々な分野での微細化にともない、新しい発想のプロセスをご提案し、積極的な微細加工技術の深化を進めています。



(写真2)
MEMS用フォトレジスト



(写真3)
MEMS用フォトレジスト

細長いボールのようなフォトレジストパターンの形成や(写真2)、数百μmのフォトレジストの膜を液状のフォトレジストで形成することも(写真3)、技術的に難度の高いものです。

※MEMS Micro Electro Mechanical Systemsの略。半導体の技術で製作される電気/機械部品の総称。インクジェットプリンターのノズル、ハードディスクドライブの磁気ヘッド、加速度センサーなどのセンサー類が実用化されています。

微細加工技術の水平的展開

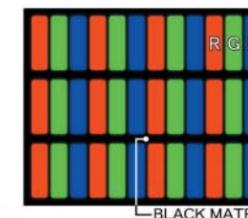
「微細加工技術の水平的展開」とは、これまで様々な分野のフォトリソグラフィで培ってきた微細加工技術を、新規分野や新規用途に広げていくことをいいます。

当社は、これまで半導体のみならずプリント配線板、フラットパネルディスプレイ、半導体パッケージ/実装、印刷製版、MEMS分野と、フォトリソグラフィを用いた微細加工技術の分野・用途を拡大してきました。

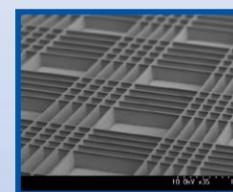
当期の特筆すべき成果は、これまで進めてきたフラットパネルディスプレイ製造分野での展開が大きく業績に寄与してきていることです。カラーフィルター用顔料分散型フォトレジストを中心とした液晶ディスプレイ製造用材料が大幅に実績を伸ばしたことに加え、製造用装置の売上が前期に続き高水準で推移するなど、当社を支える大きな事業の柱となってきています。

様々な製品で高機能化、高度化が進み、その製造工程においては一層の微細加工が今後も求められていくものと考えています。微細化の進展にともない、これまでの技術では微細化の達成が困難になるため、これから微細化のハードルが高くなる分野に対して、フォトリソグラフィを用いた微細加工技術をソリューションとして提供し、新たな領域の開拓を進めてまいります。

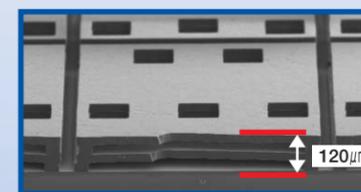
今後もフォトリソグラフィを用いた微細加工技術を新規分野、領域に展開し、新たな事業の柱の育成に注力してまいりたいと考えております。



カラーフィルター
概略図



(写真4)プラズマディスプレイ
バリアリブ



(写真5)MEMS用フォトレジスト
(フォトレジスト4層による構造体)

水平展開したプラズマディスプレイバリアリブ製造工程では、フルハイビジョン化に向けて微細化が進んでいます(写真4)。またフォトレジストパターンを複数層形成することにより(写真5)、立体的な構造物を形成するMEMS用途へ広がっています。



取締役社長 中村 洋一

2005年3月期の経営成績

2005年3月期は、半導体分野で期後半に在庫調整局面の影響を受けましたが、材料事業の業績回復が続いたことに加え、フラットパネルディスプレイ(FPD)分野での材料事業の売上伸長と、装置事業の実績が前期に続き高水準で推移したことなどから、増収増益、利益率の改善基調を堅持することができました。

これにより当社の連結ベースの経営成績は、売上高は前期比7.0%増の889億6千万円、利益面では、原油価格高騰による原材料コストの上昇があったものの、営業利益は前期比27.9%増の72億95百万円、経常利益は前期比33.4%増の80億51百万円、当期純利益は前期比7.1%

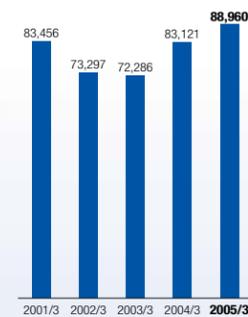
増の50億88百万円となりました。また、営業利益率は1.3ポイント改善の8.2%、経常利益率は1.8ポイント改善の9.1%となりました。

当期の利益配当金につきましては、前期に引き続き年間の普通配当を2円増額させていただきました。また当社は本年10月に創立65周年を迎えましたので、長年にわたる株主の皆様のご厚誼にお応えするため、期末配当金に創立65周年記念配当3円を加えさせていただき、年間配当金は前期と比べ1株当たり5円増配の27円となりました。

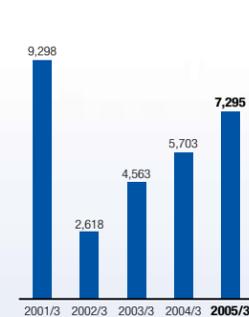
第2次「tokチャレンジ21」の進捗状況

中期計画 第2次「tokチャレンジ21」(2004年3月期～2006年3月期)の2年目となる当期におきましては、FPD分野、特に液晶ディスプレイ(LCD)分野で用いられる材料、装置の販売が順調に伸びました。LCD製造用材料および装置につきましては、当期の実績が本中期計画における2006年3月期の業績予想を2年目で上回ることとなりました。また、本中期計画の基本戦略の一つである「海外展開の強化」につきましては、目標としておりました海外売上高58%に迫る約57%となりました。

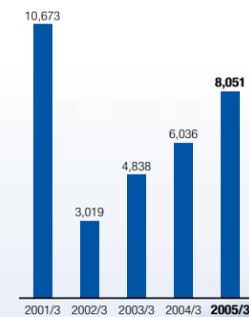
連結売上高
(百万円)



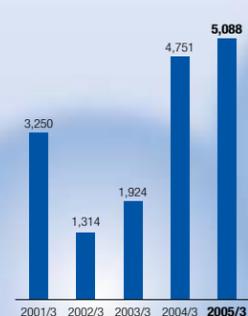
連結営業利益
(百万円)



連結経常利益
(百万円)



連結当期純利益
(百万円)



連結営業利益率
(%)



連結経常利益率
(%)



中期計画 第2次「tokチャレンジ21」の基本戦略と当期の施策・状況

目 標 :「グローバル市場で勝ち残る企業」の実現
事業領域 :「高度な微細加工技術を必要とする各分野の先端領域」

基本戦略と当期の施策・状況

■ 微細加工技術の多角的展開

- 液浸露光に関する技術の開発に注力、他に先駆けて超高解像を実現
- 新たな研究開発棟の建設・着工、液浸ステッパーの導入決定(相模事業所内)
- フラットパネルディスプレイ関連材料の開発、生産能力の増強
- 開発企画室、営業開発室の新設

■ 海外展開の強化

- フォトリソグラフィ用高純度化学薬品の生産能力の増強(台湾)
- 販売拠点の強化を目的とした現地法人設立(韓国)
- フォトリソグラフィ用高純度化学薬品の製造・販売を行う合弁会社の設立(中国)

■ 経営基盤の強化

- 業務革新および情報システムの再構築を推進

しかしながら、半導体製造用材料において、エキシマレーザー用フォトレジスト等がお客様から採用の認定をいただくなど一定の成果を得たものの、採用から量産投入までの期間が長期化していること、また、プラズマディスプレイ(PDP)製造用材料においてPDPテレビの需要が伸長しなかったこと、さらには原油価格高騰により原材料価格が上昇したことなどから、収益への影響が無視できない状況となっています。

本中期計画への積極的な取り組みを通じて、戦略面での着実な進展が見られました。目標に掲げる「グローバル市場で勝ち残る企業」を実現するため成長地域へのインフラ整備を行うなど、当社の将来の発展と成長に向けた施策を着実に実施いたしました。

中期計画 第2次「tokチャレンジ21」の取り組み状況

- **微細加工技術の「水平的展開」の充実・拡大**
新規分野や新規用途の開拓、新規プロセスや新規製品の研究・開発の遂行
- **微細加工技術の「垂直的展開」の加速・充実**
新規微細加工プロセスの提案、ソリューションビジネスの展開
- **コラボレーションの効果的な活用**
スピード、コスト、リスクなどを考慮しながら、多方面での共同研究開発や実験の実施
- **当社独自研究の強化**
研究と開発のバランス最適化による製品開発力の強化

微細加工技術の多角的展開

微細加工技術につきましては、微細化を追求する「垂直的展開」が特に半導体製造分野で目覚ましい進展を遂げております。次世代の回路形成技術として有力視されている液浸露光技術の導入促進に役立つカバーコート等の各種材料や、独自のシュリンクプロセス等を、お客様ごとのニーズに応じた解決方法として提案できるようになってまいりました。材料を個別に販売するのではなく、プロセスに応じたソリューションとして複数の材料を組み合わせることでご提案を進めております。

一方、LCD製造用材料および装置が当社の事業の柱となっておりますように、培った微細加工技術を新規分野や新規用途に広げる「水平的展開」にも力を注いでまいりました。当期の特筆すべき成果としては、液晶カラーフィルター用顔料分散型フォトレジストが環境への対応等から需要が急増、また、実装／パッケージ材料も順調に拡大するなど、水平的展開の拡大が本格的に業績に貢献してきていることが挙げられます。

このように微細加工技術における多角的展開を強化していくことにより、収益の安定性を高めていきたいと考えています。そのための施策の一環として、多角的展開の充実・拡大をさらに加速させるべく、開発企画室と営業開発室を立ち上げました。新規分野や用途の開拓、新規プロセスや製品の研究・開発を進め、新たなビジネスを創造してまいります。

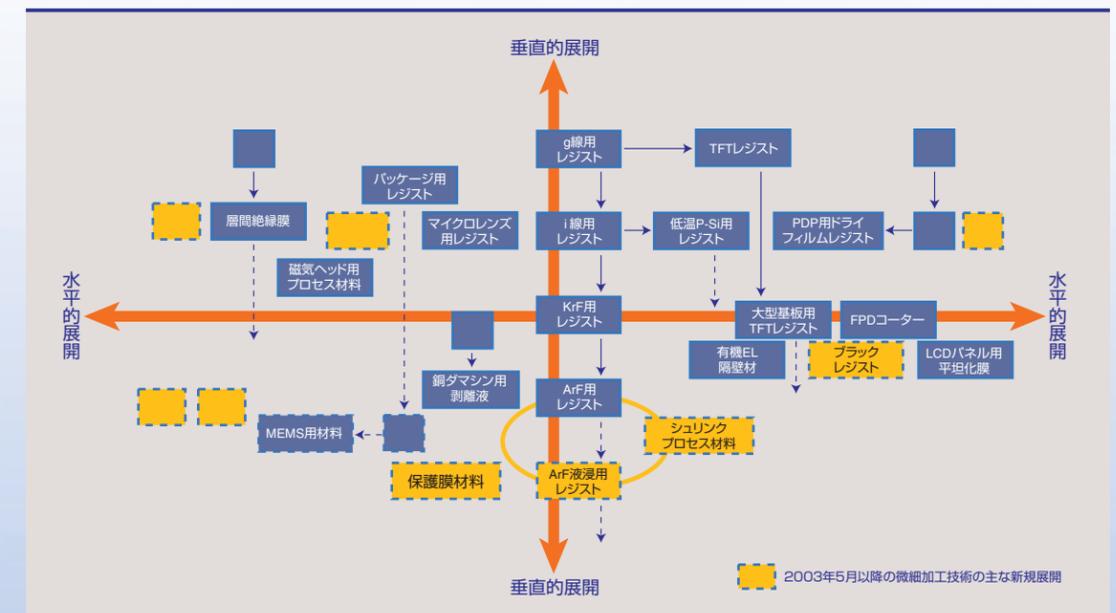
技術開発型企業として

開発面においても新たな取り組みが進んでおります。

スピード、コスト、リスク等の観点から、近年、当社では、装置メーカー、サプライヤー、大学や研究機関等とのコラボレーションの活用を重視してまいりました。そのことが開発テーマ自体や開発環境の広がりへ繋がっております。

一方、コラボレーションの有用性を強く認識しつつも、技術開発型の先進企業として独自の研究・開発にも注力しております。「コア技術の内部蓄積強化とそれに基づく独自性の発揮」を目指し、分子設計や樹脂合成等の「自らの手を使うこと」も重要視して取り組んでおります。そして、このことが将来の成長の原動力となるものと考えております。

また、次世代技術への進展を牽引し、「微細加工技術の多角的展開」を図るため、お客様との円滑なコミュニケーションはもちろんのこと、大学等の研究機関との連携やThe International Society for Optical Engineering(SPIE)といった学術会議、技術コンソーシアムに積極的に参加するなど、技術の潮流や動向に敏感に対応すべくアンテナを常に高く張っております。



微細加工技術の先頭を走り続けるために

ブランド力の強化—ナンバーワンの信頼の獲得

本中期計画で掲げた「高度な微細加工技術を必要とする各分野の先端領域」という事業領域で「グローバル市場で勝ち残る企業」という目標に向かって、様々な施策を推し進めてまいりました。中期計画は最終年度を迎え、さらにはその先の継続的な成長、発展を見据えると、今後、当社には「ブランド力」の確立が不可欠になってくるといえます。最も開発の困難な領域で実績をあげ、品質管理力、営業力、財務力、社会性等、会社の総合力を着実に高めていくことで、「微細加工なら東京応化」とお客様から支持や信用・信頼感を常に得られるような「ブランド力」を一丸となって構築していくことが重要だと考えております。お客様が新たな挑戦をするときや、技術的課題に悩まされたときに「まずは東京応化に相談を」という信用・信頼感を獲得することが持続的な成長、発展への礎となるものと確信しております。

半導体製造分野は微細加工技術のフラッグシップ

当社が手がけているフォトリソグラフィを用いた微細加工技術は、半導体や半導体パッケージ、LCDやPDP等のFPDパネル、インクジェットプリンターのヘッド部分、圧力センサーや加速度センサー等の各種センサーといった幅広い分野で活用されます。なかでも半導体製造分野では、100nm以下というナノテクノロジーの領域にあり、際立って微細化の進展した最もチャレンジングな分野といえます。

この分野での成功が技術力や品質管理能力等の会社の総合力に対する高い評価に結びつくことを考えますと、当社のブランド力を高めるには半導体製造分野を「微細加工技術のフラッグシップ」と位置づけ、必要な経営資源を投入するなど最先端技術の開発、品質管理を推進していく必要があります。液浸露光対応のArFエキシマレーザー露光装置等の最先端の関連機器導入といった大規模な投資も、当社の価値を創造していくために必要な要因といえます。



微細化の進展や競争の激化により厳しい状況が続く分野ではありますが、微細加工技術の先端領域の開拓を続け、最も困難な領域で実績を積み重ねることによって先頭を走り続け、確固たるリーダーシップを発揮していきたいと考えております。

事業リスク等のマネジメントをより一層重視

微細化の進展による技術の高度化にともない、開発に必要な研究開発費の高騰、技術革新スピードの加速等、企業が負うべき事業リスクは増大しています。特に大規模な研究開発、設備投資等が欠かせない半導体製造分野で垂直的展開を図るためには、リスク回避が一層重要となっております。

そのため当社では、こうした最先端領域での事業リスクを認識したうえで、リスクマネジメントの強化に取り組んでおります。現在は、最先端領域で培った技術を他分野での製品開発や新たなソリューション提供に活用するなど「技術の水平的展開によるリスクの分散化」、研究開発、マーケティング生産における拠点や体制を見直すなどの「オペレーション体制の最適化によるリスクの抑制・低減」、独自の研究・開発とコラボレーションの活用バランスを考慮した「最適なR&D推進体制の構築および開発リスクの抑制・低減」を柱とした施策を進めております。



変化し続ける環境に適応する

企業にとっての命題は事業の収益力を高め、長期的に安定成長を続けるということであり、時代の変化、社会環境の変化に適応できる企業のみが次の世代への活路を見出せると考えております。

これからの時代に求められる企業のあり方は大きく変化しており、特に環境保全をはじめとする社会との共生に向けた取り組みは克服すべき課題となっております。こうした大きな時代の転換点を迎え、当社も経営環境の変化に機敏に適応し、内側から沸き起こる「変化」を促しながら、持続的成長が可能な企業を目指して邁進してまいりたいと存じます。

今後も株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様からより高い信頼と満足をいただけるよう努めてまいりますので、一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2005年10月

取締役社長 中村洋一

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する主な施策

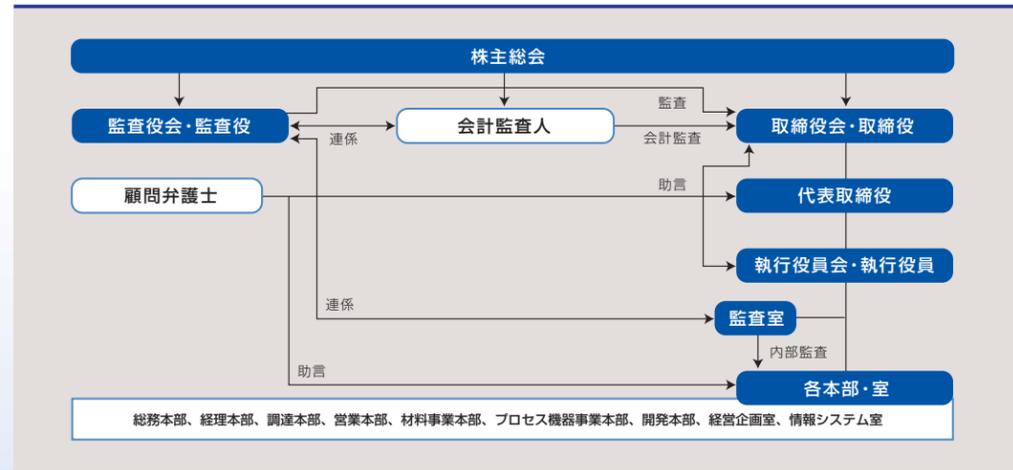
当社は、ステークホルダーの皆様からより高い信頼と満足を寄せられる企業を目指し、経営の透明性、健全性ならびに意思決定の迅速化等による効率性を確保するためのコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置づけ、その達成に鋭意取り組んでおります。

会社の機関等の内容

当社は、監査役設置会社として監査役制度を採用しております。これは、商法等の改正にともない権限が強化された監査役による監査の充実を図るとともに、取締役会の改革と執行役員制度の導入・定着等により経営を強化することがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効と判断しているためです。

また、当社では、「経営意思決定・経営監督」および「業務執行」の各機能の強化と責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しておりますが、同制度の導入を中心としたガバナンス機構改革の成果をより確かなものとするため、取締役会および執行役員制度の改革を実施いたしました。

取締役・取締役会 コーポレート・ガバナンス体制



2004年6月29日開催の第74回定時株主総会終結後、役付取締役を取締役会長と取締役社長(いずれも代表取締役)に限定する一方、その他役付取締役を置かないことにより、原則として取締役会を「代表取締役」と「取締役」のみとし、取締役会に本来求められる「経営意思決定・経営監督」機能の発揮に適した形態に改めました。

現在、取締役は8名で、業務執行に関する重要事項等を決定するとともに、代表取締役および取締役の職務執行を監督することを目的に、取締役会を原則として毎月1回開催しております。

執行役員・執行役員会

取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実を図る一方、「業務執行」機能のさらなる強化に向け、各執行役員が担当する職務の責任領域・能力等を総合的に勘案して、「執行役員社長」以下、「常務執行役員」「執行役員」等の階層的な役位を設定するとともに、新たに全執行役員で構成する「執行役員会」を設置いたしました。

現在、執行役員は15名で、取締役会における決定事項の指示・命令、執行役員相互の活動情報の共有化および取締役会付議基準未滿の一定の重要事項の意思決定等を目的に、執行役員会を原則として毎月1回開催しております。

監査役・監査役会

現在、監査役は4名(うち、社外監査役3名)で、監査に関する重要事項について各監査役から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、監査役会を原則として毎月1回開催しております。

監査室

内部統制の一環として、取締役社長直轄の監査室を設置し、専任スタッフが監査役との関係を取りながら定期的に必要な内部監査を実施することにより、法令や社内規程等の遵守状況の調査と指導を行っております。

コンプライアンスに関する主な取り組み

全従業員一人ひとりのコンプライアンスに対する意識向上を図るとともに、共有する価値観と行動規範を明確にすることを目的として、2004年10月6日付で制定した「TOKグループ・コンプライアンス行動基準」を2005年4月1日より施行いたしました。さらに、この施行に合わせて、各種法令・行動基準違反等の事実の早期発見・解決を図る目的で、各役職員からの通報を受け付ける制度(内部通報制度)も整備し、運用しております。なお、通報者保護のため、当社内に設置する「コンプライアンスほっとライン」(社内ルート)に加え、当社顧問弁護士(弁護士事務所)への通報ルート(社外ルート)を設けることにより、状況に応じて通報先を選択できるよう便宜を図っております。

環境保全活動

化学産業は、事業の特性上多くの化学物質を取り扱うことから環境に多大な影響を及ぼす可能性があり、他業界と比べて常に厳しい目をもって見られる産業であるといえます。しかし、人々の暮らしに多くの利益・利便性をもたらす重要な産業であることも間違いありません。

当社は、レスポンシブル・ケアの精神にのっとり「製品開発から廃棄にいたる全ライフサイクルにわたって自己決定・自己責任の原則に基づき安全を確保し、健康・環境を守るために最善を尽くす」という意識を持って日々取り組んでおります。そして、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造とは対極にある循環型社会の実現に向けて、ゼロエミッションを目標とした環境経営を推進しております。詳細につきましては、「環境・社会報告書」を発行し、当社の1年間の環境保全活動と社会とのかかわりについて報告しております。

今後とも当社は、「企業と社会の持続的な発展を担いながら、地球環境を守る」ことの実践を常に念頭に置き、環境経営推進により一層努めてまいります。

環境保全費用額の推移



環境保全投資額の推移



環境保全活動に伴う経済効果 (実質的効果) の推移



会社概要

(2005年3月31日現在)

社名 : 東京応化工業株式会社
 設立 : 1940年10月25日
 本社 : 〒211-0012
 川崎市中原区中丸子150番地
 従業員数 : 1,397名
 資本金 : 146億4,044万8千円
 株主数 : 11,487名

上場証券取引所 : 東京証券取引所市場第一部
 お問い合わせ先 : 広報部
 〒211-0012
 川崎市中原区中丸子150番地
 TEL : 044-435-3000
 FAX : 044-435-3020



役員一覧

(2005年10月1日現在)

取締役

取締役会長	内田 春彦	
取締役社長 執行役員社長	中村 洋一	
取締役 常務執行役員	青山 俊身	プロセス機器事業本部長
	小峰 孝	開発本部長
	開発 宏一	総務本部長
	逸見 至保	経理本部長
取締役	中山 宗雄	
	古谷 明	

監査役

常勤監査役	杉山 元康	
	木谷 佳夫	
監査役	檜垣不二夫	菱進都市開発株式会社取締役社長
	羽山 幸男	

執行役員

執行役員	宮城 豊	プロセス機器事業本部副本部長
	任田 博行	材料事業本部長兼画像材料事業部長
	堀越 昭則	経営企画室長
	古谷 仁	調達本部長
	岩崎 光文	営業本部長兼電子営業二部長
	大田 勝行	営業本部副本部長兼業務管理部長
	浅羽 洋	材料事業本部副本部長兼電子材料事業部長
	小原 秀克	情報システム室長
	田澤 賢二	オーカヨーロッパ社取締役社長
	駒野 博司	開発本部副本部長兼開発企画室長



ホームページ上のIR情報

- IR動画配信
 - 機関投資家・アナリスト向け決算説明会、
 - 会社案内ビデオ(日本語・英語・中国語・韓国語)
- 株式情報
 - 株式の状況・株価情報・配当金の推移
- IRカレンダー
- 財務データ
 - 業績概要・業績推移・決算短信等
- IRライブラリ
 - アニュアルレポート・事業報告書・有価証券報告書・説明会資料等
- 株式に関するお手続き
- 今日の株価
- FAQ(よくあるご質問)
- IRお問い合わせ窓口



IR情報



<http://www.tok.co.jp/index-j.htm>



新技術のご紹介

将来見通しに関する注意事項

本アニュアルレポートに記載の将来に対する見通し、予想等につきましては、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。したがって、実際の業績は様々な重要な要因により、この業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があるため、この業績見通しに全面的に依拠されませんようお願いいたします。また、その時点以降に修正されている場合があるため、最新の資料をご入手いただくなど、必ずご確認くださいませますようお願いいたします。

〒211-0012
川崎市中原区中丸子150番地
TEL. 044-435-3000(代表)
FAX. 044-435-3020
<http://www.tok.co.jp/>

tok 東京応化工業株式会社



このレポートは古紙配合率100%再生紙を使用しており、
かつ環境に配慮した大豆油インキを使用しています。
051200.5 NIR. AUMZ